DIALOG(R) File 347: JAPIO (c) JPO & JAPIO. All rts. reserv.

01940847

PREPARATION OF LIQUID JET RECORDING HEAD

PUB. NO.: 61-154947 A]

PUBLISHED: July 14, 1986 (19860714)

INVENTOR(s): NOGUCHI HIROMICHI

APPLICANT(s): CANON INC [000100] (A Japanese Company or Corporation), JP

(Japan)

APPL. NO.: 59-274689 [JP 84274689] FILED: December 28, 1984 (19841228)

INTL CLASS: [4] B41J-003/04

JAPIO CLASS: 29.4 (PRECISION INSTRUMENTS -- Business Machines)
JAPIO KEYWORD:R005 (PIEZOELECTRIC FERROELECTRIC SUBSTANCES); R105

(INFORMATION PROCESSING -- Ink Jet Printers); R119 (CHEMISTRY -- Heat Resistant Resins); R124 (CHEMISTRY -- Epoxy Resins)

JOURNAL: Section: M, Section No. 540, Vol. 10, No. 357, Pg. 136,

December 02, 1986 (19861202)

ABSTRACT

PURPOSE: To obtain an inexpensive and precise liquid jet recording head also high in reliability, by providing a solid layer on a substrate in a liquid flow channel pattern and providing at least a part of a liquid flow channel constituting member onto the above mentioned substrate and subsequently removing the solid layer from the above mentioned substrate.

CONSTITUTION: A desired number of liquid emitting energy generation elements 2 such as electrothermal converters or piezoelectric elements are arranged on a substrate 1. A solid layer 3 is laminated to the liquid flow channel forming scheduled part on the substrate 1 containing a liquid emitting energy generation element 2 and a liquid flow channel constituting member 4 is laminated to the substrate 1, to which the solid layer 3 was formed, so as to cover said solid layer 3. The solid layer 3 is removed from the substrate, to which the solid layer 3 and the liquid flow channel constituting member 4 were laminated, to form a liquid flow channel. By this method, a liquid jet recording head, wherein desired liquid flow channels 5 are formed at the desired position on the substrate 1 provided with the liquid emitting energy generation element 2, is constituted.

```
DIALOG(R) File 345: Inpadoc/Fam. & Legal Stat.
(c) 1996 European Patent Office. All rts. reserv.
6027026
Basic Patent (No, Kind, Date): DE 3546063 Al 860703 <No. of Patents: 006>
Patent Family:
                Kind Date
                                              Kind Date
                                 Applic No
    Patent No
               A1 860703
                                DE 3546063
                                              A 851224
                                                           (BASIC)
    DE 3546063
   DE 3546063 C2 911010

JP 61154947 A2 860714 JP 84274689 A

JP 94045242 B4 940615 JP 84274689 A

870414 US 811460 A

US 1174 A
                                                   851224
                                                  841228
                                                   841228
                                                   851220
                                                   870107
Priority Data (No, Kind, Date):
    JP 84274689 A 841228
    US 811460 A1 851220
PATENT FAMILY:
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC (DE)
  Patent (No, Kind, Date): DE 3546063 Al 860703
    VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES FLUESSIGKEITSSTRAHLAUFZEICHNUNGSKOPFES
    Patent Assignee: CANON KK (JP)
    Author (Inventor): NOGUCHI HIROMICHI (JP)
    Priority (No, Kind, Date): JP 84274689 A 841228
    Applic (No, Kind, Date): DE 3546063 A 851224
    IPC: * B41J-003/04
    Derwent WPI Acc No: * G 86-177354
    Language of Document: German
  Patent (No, Kind, Date): DE 3546063 C2 911010
    VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES FLUESSIGKEITSSTRAHLAUFZEICHNUNGSKOPFES
    Patent Assignee: CANON KK (JP)
    Author (Inventor): NOGUCHI HIROMICHI
                                           (JP)
    Priority (No, Kind, Date): JP 84274689 A 841228
    Applic (No, Kind, Date): DE 3546063 A 851224
    Filing Details: DE C2 D2 Grant of a patent after examination process
    IPC: * B41J-002/16; B41J-002/05
    CA Abstract No: * 107(14)124699G
    Derwent WPI Acc No: * G 86-177354
    JAPIO Reference No: * 100357M000136
    Language of Document: German
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC (DE)
  Legal Status (No, Type, Date, Code, Text):
    DE 3546063
                  P
                       841228 DE AA
                                           PRIORITY (PATENT APPLICATION)
                               (PRIORITAET (PATENTANMELDUNG))
                               JP 84274689 A
                                                841228
                                            DOMESTIC APPLICATION (PATENT
    DE 3546063 P
                      851224 DE AE
                               APPLICATION) (INLANDSANMELDUNG
                               (PATENTANMELDUNG))
                               DE 3546063 A
                                               851224
                       860703 DE A1
                                            LAYING OPEN FOR PUBLIC
    DE 3546063
                  P
                               INSPECTION (OFFENLEGUNG)
                                            REQUEST FOR EXAMINATION AS TO
                       860703 DE OP8
    DE 3546063
                  Ρ
                               PAR. 44 PATENT LAW (PRUEFUNGSANTRAG GEM.
                               PAR. 44 PATG. IST GESTELLT)
                                            DIVIDED OUT TO: (AUSGESCHIEDEN
                       900419
                              DE R171
    DE 3546063
                  P
                               ODER ABGETEILT NACH:)
                               DE 3546794 P
                                            SUPPLEMENTARY DIVISION/PARTITION
                       900419 DE 8172
    DE 3546063
                  Ρ
                               IN: (NACHZUTRAGENDE AUSSCHEIDUNGS- ODER
                               TEILUNGSANMELDUNG IN:)
                               DE 3546794 P
```

911010 DE AH

DE 3546063

DIVISION IN (AUSSCHEIDUNG IN)

```
DE 3546794 P
                                          GRANT AFTER EXAMINATION
                 P
                     911010 DE D2
   DE 3546063
                             (PATENTERTEILUNG NACH DURCHFUEHRUNG DES
                             PRUEFUNGSVERFAHRENS)
                     920409
                                          NO OPPOSITION DURING TERM OF
                 P
                             DE 8364
   DE 3546063
                             OPPOSITION (EINSPRUCHSFRIST ABGELAUFEN OHNE
                             DASS EINSPRUCH ERHOBEN WURDE)
                                        DIVIDED OUT OF (SUPPLEMENT):
   DE 3546794
                 Ρ
                     900419
                             DE R172
                              (AUSGESCHIEDEN ODER ABGETEILT VON
                              (NACHTRAG):)
                             DE 3546063 P
                                          DIVISION OF: (AUSSCHEIDUNGS-
                 P
                     900419
                             DE 8171
   DE 3546794
                             ODER TEILUNGSANMELDUNG AUS:)
                             DE 3546063 P
   DE 3546794
                 P
                     900712
                             DE 8110
                                         REQUEST FOR EXAMINATION
                             PARAGRAPH 44 (EINGANG VON PRUEFUNGSANTRAEGEN
                             PAR. 44)
                             DE 8128
                                          NEW PERSON/NAME/ADDRESS OF THE
   DE 3546794
                 P
                     910404
                             AGENT (AENDERUNG IN PERSON, NAMEN ODER
                             WOHNORT DES VERTRETERS)
                             TIEDTKE, H., DIPL.-ING. BUEHLING, G.,
                             DIPL.-CHEM. KINNE, R., DIPL.-ING. GRUPE, P.,
                             DIPL.-ING. PELLMANN, H., DIPL.-ING. GRAMS,
                             K., DIPL.-ING., PAT.-ANWAELTE, 8000 MUENCHEN
                 P
                     911010
                             DE AC
                                         DIVIDED OUT OF (AUSSCHEIDUNG
   DE 3546794
                             AUS)
                             DE 3546063 P
JAPAN (JP)
 Patent (No, Kind, Date): JP 61154947 A2 860714
   PREPARATION OF LIQUID JET RECORDING HEAD (English)
   Patent Assignee: CANON KK
   Author (Inventor): NOGUCHI HIROMICHI
   Priority (No, Kind, Date): JP 84274689 A
                                             841228
   Applic (No, Kind, Date): JP 84274689 A 841228
   IPC: * B41J-003/04
   JAPIO Reference No: * 100357M000136
   Language of Document: Japanese
 Patent (No, Kind, Date): JP 94045242 B4 940615
   Priority (No, Kind, Date): JP 84274689 A 841228
   Applic (No, Kind, Date): JP 84274689 A
   IPC: * B41J-002/16
   CA Abstract No: * 107(14)124699G
   Derwent WPI Acc No: * G 86-177354
   JAPIO Reference No: * 100357M000136
   Language of Document: Japanese
UNITED STATES OF AMERICA (US)
 Patent (No, Kind, Date): US 4657631 A
                                         870414
   PROCESS FOR PRODUCING A LIQUID JET RECORDING HEAD (English)
   Patent Assignee: CANON KK (JP)
   Author (Inventor): NOGUCHI HIROMICHI (JP)
   Priority (No, Kind, Date): JP 84274689 A
                                             841228
   Applic (No, Kind, Date): US 811460 A 851220
   National Class: * US 156655000; US 156272200; US 156629000; US
      156645000; US 156668000
   IPC: * B44C-001/22; B29C-017/08; C03C-015/00; C03C-025/06
   CA Abstract No: * 107(14)124699G
   Language of Document: English
  Patent (No, Kind, Date): US 4775445 A
                                         881004
   PROCESS FOR PRODUCING A LIQUID JET RECORDING HEAD (English)
   Patent Assignee: CANON KK (JP)
   Author (Inventor): NOGUCHI HIROMICHI (JP)
   Priority (No, Kind, Date): US 811460 A1 851220; JP 84274689 A
      841228
   Applic (No, Kind, Date): US 1174 A
```

Addnl Info: 4657631 870414 Patented

National Class: * 156637000; 156272200; 156629000; 156630000;

156633000; 156651000; 156655000; 156668000

IPC: * B44C-001/22; B29C-037/00; C03C-015/00

CA Abstract No: * 107(14)124699G Derwent WPI Acc No: * G 86-177354
JAPIO Reference No: * 100357M000136
Language of Document: English

UNITED STATES OF AMERICA (US)

MITED SIVIES C			
Legal Status	(No, Ty	pe, Date,	Code, Text):
US 4657631			
			JP 84274689 A 841228
US 4657631	P	851220	US AE APPL. DATA (PATENT)
			US 811460 A 851220
us 4657631	P	870414	US A PATENT
US 4657631	P	870922	US CC CERTIFICATE OF CORRECTION
US 4775445		841228	US AA PRIORITY (PATENT)
	_		JP 84274689 A 841228
us 4775445	P	851220	US AA PRIORITY
00 1,,0110	_		US 811460 A1 851220
us 4775445	P	870107	US AE APPLICATION DATA (PATENT)
05 4//5445	-		(APPL. DATA (PATENT))
			US 1174 A 870107
US 4775445	P	881004	US A PATENT
• • • • • • • •	-		
US 4775445	P	890418	US CC CERTIFICATE OF CORRECTION

®日本国特許庁(JP)

10 特許出願公開

母 公 開 特 許 公 報 (A) 昭61 - 154947

@Int, Cl.4

識別記号

庁内整理書号

母公開 昭和61年(1986)7月14日

B 41 J 3/04

103

7513-2C

審査請求 未請求 発明の数 1 (全9頁)

母発明の名称

液体噴射記録ヘッドの製造方法

②特 既 昭59-274689

经出 類 昭59(1984)12月28日

母 発明者 野口

弘 道 東京都大田

の出 顔 人 キャノン株式会社

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内

社 東京都大田区下丸子3丁目30番2号

20代理人 弁理士 若林 忠

明 越. 食

1. 発明の名称

療体吸射記録へッドの製造方法

2.特許請求の範囲

- (1) 地級上に被使路のパターン状に関係所を設ける工程と、被関係層が設けられた教記施級上に被 流路構成機材の少なくとも一部を設ける工程と、 前記医体層を前記施板上より缺去する工程となり ことを特徴とする液体機計記集ペッドの製造力 法。
- (2) 前記国体層を感光性材料で形成することを特徴とする特許請求の範囲第1項に記載の液体取射記録へッドの製造方法。
- (3) 前起感光性材料が、插性光線によって可溶化 するポジ型ドライフィルムであることを特徴とす る件件請求の範囲終2項に記載の速 改計記録 ヘッドの製造方法。

3. 処明の詳細な説明

[武策上の利用分野]

水見明は、インクジェット記載方式に用いる記

起冊被小額を発生するための液体噴射記録へっト の製造方法に関する。

〔従来の技術〕

しかしながら、斯かる従来法によって作成される破体験解記録へっドでは、切削加工される被政
助内禁固の荒れが大きすぎたり、エッテング の
差から被統略に歪が生じたりして、流路疾れ記録
一定した被旋路が 難く、製作後の液体嗅射記録
へっドの記録並吐出特性にバラッキが出易いと
さった問題があった。また、切削加工の数に扱の

欠けや割れが生じ易く、製造を留りが選いと言う 欠点もあった。また、エッチング加工を行よる 特 会には、製造工程が多く、製造コストの上昇を相 くとは、製造工程が多く、製造コストの上昇を相 くとさかれた。要には、上記を付金に共 にはった点として、被送を形成した。 記録中では、というの生出エネルを の生出されたのの生出エネルを の生かでないた。 の生のでは、というの を対するに、これを のないでは、 の

また、液体受射記録へっドは、適常その使用の 切下にあっては、記録液(一般には、水をいはないインク液、あるいはないインク液、あるいはない が存取を主体とするインク液等)と常時を検索しても がある。それ故、液体吸射記録へっドを感出すると で、これないないない。また逆に容は、 定係でを起こすことがなく、また逆に容は、 を係ることがなく、また逆に容は、 を係ることがなく、またが望まれるが で、記録とのないものであることが望まれるあっ と記述来述においては、加工方法等の制

板上より除去する工程と各ひことを特徴とする症 体質射記録へっドの製造方法である。

[発明の実施欺攝]

以下、必要に応じて図面を参照しつつ、本発明 を詳細に説明する。

第1回乃至第8回は、本発明の落本的な思議を 説明するための核式図であり、第1回乃至部6回 のそれぞれには、本発明の方法に係る液体喰射記 はつっドの構成とその製作手順の一側が示されて いる。尚、本例では、2つのオリフィスを有する 液体吸射記録へっドが示されるが、もちろんこれ は上のオリフィスを有する高速度マルチアレイ被 体吸射記録へっドの場合あるいは1つのオリフィ スを有する液体吸射記録へっドの場合でも同様で あることは言うまでもない。

まず、本意様においては、例えば第1例に示されるような、ガラス、セラミックス、プラスチックあるいは会議等から成る茶板1が用いられる。 尚、第1回は関体所が成前の茶板の検文的針視図である。 て、必ずしもこれら目的にかなった材料を選択することができ かった。

[発明が解決しようとする問題点]

本処明は上記の語点に鑑み成されたものであって、安保、精密であり、また信頼性も高い液体吸附記録へッドを供給し得る新風な液体吸附記録へッドの製造方法を提供することを目的とする。

また、彼沈路が特度及く正確に且つ歩音り良く 戦闘和工された構成を有する液体吸射記録へッド ・を供給することが可能な新規な液体吸射記録へっ ドの製造力法を提供することも目的とする。

また、記録液との相互影響が少なく、依頼的強 成や耐薬品性に優れた液体噴射記録へッドを供給 し得る新規な液体噴射記録へッドの製造方法を提 供することも目的とする。

[問題点を解決するための手段]

上記目的を連載する本発明は、蒸板上に液流路 のパターン状に関係層を設ける工程と、練図体層 が設けられた痕記茶板上に液流路構成部材の少な くとも一部を設ける工程と、前記図体層を前記茶

このような茶板1は、被洗路構成部計の一部と して機能し、また技法の固体層および滋定路構成 部材設局時の支持体として破骸し得るものであれ ば、その歴状、材質等、特に展定されることなく 使用することができる。上記蓄板1上には、電気 **急 変換 体 あるい は圧 電 妻子 等の 液 体 吐 出 エ ネ ル** ギー発生素子でが所望の個数記数される(扨1図) では2回)。このような液体吐出エネルギー発生 素子でによって記録液小滴を吐出させるための吐 山エネルギーがインク被に与えられ、記録が行な われる。因に、例えば、上記機体吐出エネルギー 発生素子2として電気熱変換体が用いられるとき には、この業子が、近傍の記録彼をか為すること により、吐出エネルギーを発生する。また、外え は、圧電電子が用いられるときは、この電子の説 杖的観動によって、吐出エネルギーが発生され

商、これ等の業子を比は、これら妻子を効作させるための制御 与入力用電機(不図示)が接続されている。また、一般にはこれら吐出エネル

ギー発生素子の新用性の向上等を目的として、保護所等の各種の機能層が設けられるが、もちろん 本発明においてもこのような機能層を設けること は一向に差しつかえない。また、本例において は、生出エネルギー発生素子を被逸路形成前に基 版上に民政したが、民政時期は所護とし得る。

次いで、上名政体化出エネルギー発生素子 2 を 会 び 基板 1 上の 被 提路 形成予定部分に、 例えば 第 2 図(A) および(B) に示されるような 選 体 層 3 を 状 層 する。 尚、 第 2 図(A) は、 固 体 層 積 層 後 の 基 板 の 検 式 的 平 函 図 で あり、 第 2 図(B) は 第 2 図(A) の A - A ・線 で 切断した 基級の 検 式 的 切断 図 で ある。

上記図作用3は、後途するような技能路構成性 材が技力された後、基級1から除収され、放映去 部分に液流路が構成される。もちろん、液流路の 形状は所望のものとすることが可能であり、放流 路形成のために設けられる上記図体局3も放流路 形状に応じたものとすることができる。因に、太 例では、2つの吐出エネルギー気化素子に対応し

光線照射によって、現象液に可容化するポジ型ドライフィルム、主たネガ型ドライフィルムであれば、光盤合型であるが塩化メチレンあるいは強アルカリで溶解あるいは射差快去し得るネガボドライフィルムが進している。

ポジ型ドライフィルムとしては、具体的には、 例えば「OZATZC R225」(商品名、ヘキストジャ パン(按)】等、またネガ型ドライフィルムとし ては、「OZATEC Tシリーズ」(商品名、ヘキスト ジャパン(校))、「PHOTEC PHTシリーズ」(商 品名、日文化成工業(検))、「RISTON」(商品 名、デュ・ポン・ド・ネモアース・Co) 守が用い られる。

のに挙げた時期可能性ポリマーとしては、それを 新聞する お割が存在し、コーティングによって 被 観 形成し 所る 高分子化合物 であればい ずれでも 用い得る。ここで用い得るフェトレジスト 暦 としては、 美 尽的には ノボラック 型フェノー ル 樹 殿 とナフトキノングアグドから成るボジ型 飛 状フェトレジスト、ポリビニルシンナメートから 成る ネガ

て設けられる2つのオリフィスのそれぞれから記録被小妻を吐出させるため、遺迹路は、2つに分放された寂寞建路と鉄旋路に記録液を供給するための共通疲害とで構成される。

このような関係層3を構成するに関して用いられる材料および手及としては、例えば下記に列集するようなものが具体的なものとして挙げられる。

① 総光性ドライフィルムを用い、所頭ドライフィルムの頻像形成プロセスに従って因体層を形成する。

の 花板 I 上に所望の序さの窓前可容性ポリマー およびフォトレジスト層を順に極層し、 はフォト レジスト 暦の パターン 形成後、 容 門可容性ポリ マー曜を選択的に執去する。

の硬化性を有するか、または非硬化性の樹脂を 印刷する。

のに挙げた感光性ドライフィルムとしては、 ポン 間のものもネガ型のものも用いることができるが、例えばポン数ドライフィルムであれば、 活性

及在状フォトレジスト、現化ゴムとピスアジドから成るネガ型液状フォトレジスト、ネガ型感光性ドライフィルム、無硬化型および燃外線硬化型のイン中等が挙げられる。

のに挙げた印票法によって関体層を形成するも 料としては、例えば藻品を登型、 熱硬化型あるい は然外級硬化理等のそれぞれの乾燥方式で用いら ている平板インキ、スクリーンインキ等が用いら れる。

以上に挙げた材料群の中で、加工特限や除去の

む易性あるいは作業性等の例から見て、①の感光

性ドライフィルムを用いる手段が好ましく。その
中でもポジ型ドライフィルムを用いるのが特には
ましい。すなわち、ポジ型感光性材料は、例えば
解他度がネガ型の感光性材料よりも優れている。
レリーフパターンが重変かつ平滑な側を関射が
力、レリーフハターを現像液や有級溶剤で溶射が
力できる等の特長を有しており、本発明における
関体が形成材料として好ましいものである。その
中でも、ドライフィルム状のものは、10~100 xm

の序葉のものが 与れる点で、最も好ましい材料である。

上記図体層3が影響された蓄板1には、例えば 第3間に示されるように、数国体局3を覆うよう に放送路線成離材4が接層される。尚、第3回は 被波路線成都材接層後、第2回と阿福の位置で切 減した基根の核玄的切前側回である。

外線硬化などの場合は、漁常10分以内の減時間の 照射によって硬化が可能である。

次いで、固体層3分よび液流路構成部材4が投 層された上品のような基板から、関体層3を輸出 して液流路を形成する。

関作層3の執去手段としては特に限定されるものではないが、具体的には例えば関係層3を溶解または影響あるいは別様する環体中に基底を優強して独去する等の方法が行ましいものとして挙げられる。この概、必要に応じて組音彼処理、スプレー、加熱、微拌、その他の除虫促進手段を用いることも可能である。

上記除点半段に対して用いられる液体としては、例えば合ハロゲン炭化水素、ケトン、エステル、芳香族炭化水素、エーテル、アルコール、X-メテルピロリドン、ジメテルホルムアとド、フェノール、水、強アルカリを含む水、等が げられる。これの液体には、必要に応じてポジ型ドライフィルムを用いる場合には、除去を容易にするた

る。また、世界ノッキ、集着、スパッグリング等で設計できる全属も行道に用いられる。これらの例としては、Gu、Ag、Au、Ri、Gr、Sa、Pb、Za、Ai、Ti等である。高着やスパッタリングを用いれば、全属の酸化物、硫化物等の化合物も用いることができる。

た都被状の硬化性材料が複雑路構成器材として 用いられる場合には、放材料は、例えばカーテン コート、ロールコート、スプレーコート等の公知 の手段を用い、これを増加する等の方法によっ て、所増の解さで基板上に接着される。協力に限 しては、放材料の関気を行なった後、気息の名入 を避けながら行なうのが行ましい。

ここで、例えば第3回のように被疑路構成長付4を破損する際、上記のような被状の硬化性材料が用いられる場合には、強硬化性材料は、例えば液体の流出、変動を抑制した状態で、必要ならば上部に抑え破を重ね、所定の条件で硬化させられる(第4回参照)。硬化条件が常温または加熱硬化であれば、20分~2時間放棄すれば良く、需

めに関体層に改めて供外級照射を施士のが舒まし く、その他の材料を用いた場合は、40~80℃に放 体を加払するのが舒ましい。

第6図には、上記のような選体着3の除去を、 商解によって行なった場合の例が示されている。 尚、第6図は、選体層の容解除去に先立って被供 約ロ5を設け、その後に関体層を除去した後の被 体強射記録ヘッドの模式的斜視図が示されてい る。第5図は、異体層3除去後、第2図と阿様の 位置で切断した液体噴射記録ヘッドの模式的切断 個別である。

本例の場合、固体層3は、計画体を溶解する統体中に浸透され、ヘッドのオリフィスと放供地口Bを通して溶解散去される。溶解験去に免立ち、オリフィス先端が露出していなければ、例えば第6回のC-C'の値に拾って基板全体を切跡し、オリフィス先級を露出させる。

しかし、このような落板のオリフィス先輪部の 切断の機 は、本発明の実施のために必ずしも必 型ではなく、例えば複数路線は餌分として破状の 使化性材料を用い、放材料を放射する際に型を使用し、オリフィス先編件が閉じて使われてしまうことがなく、且つオリフィス先編部が平滑に成復されるようにした場合等には、切断は不要である。

以上のようにして、吐出エネルギー発生素子 2 が設けられた基板 1 上の房間の位置に、房間の位置に、房間の位置に、房間の位置に対した液体噴射影響へマドが構成された液体噴射影響へマドが構成される。 尚に沿って切断する。これは、水水とよりフィスとの関系を最適化する。 また、必要に応じてオリフィスとの関系を最適はは、スカリスとなってあり、ここで切断する情はは、スカリスとのであり、ここでが応じてオリフィスとのである。 また、必要に応じてオリフィスカリスとなってもよい。

更には、例えば筋で図に示されるように、関体 層形成後、所望の厚さに液液路構成部材を検暦 し、上記回様の操作によって面体層を除去して流 路壁でのみをこれら液流路構成部材で形成し、次

部 B 図の構成の液体噴射記録へッドを作成した。

上記問機の操作手順で、上記同様の関係層を被 恐した強靭を合計る値、成した後、以関係層が形 成されている指板のそれぞれに、第1表に示す液 状の硬化性材料を程度した。操作手扇は以下のよ うに行なった。

野1裏のイーニの硬化性材料のそれぞれを、必要に応じて触媒(ロ、ハ、ニにおいては、1 仮

いで所望の天板9を貼合わせることによって液体 放射記集へッドを構成することも可能である。 内、第7回には貼合わせ前の液 咳射記録へッド の使式的斜視器が示されている。

本質において、複路整7と図体層の高さとを 同一にした場合には、図体層の放出は天坂9を貼 合わせた後に行なってもよいし、また、貼合わせ 遊に行なってもよいが、図体層放出後に天坂9を 貼合わせることにより、図体層の飲出を一層確実 にすることができ、歩頭りの向上、ひいては生産 性の向上をはかることができる。

尚、本発明における被提路構成部材は、例えば 第7回の似く変略を7と天板9とが分散されたも のであってもよいし、また、例えば第8回の如く それらが一体心されたものであってもよい。

[実施例]

以下に実施例を示し、本品等を更に詳細に説明 する。

実進例 1

第1 図乃至第6 図に示した製作半額に輩じて、

量労のメチルエチルケトンパーホキサイドを抵加した)あるいは硬化剤と製合し、真空ポンプを用いて脱泡した。その後、上記脱泡した4種の硬化性材料のそれぞれを、前窓選体質が破局されているお扱のそれぞれにアプリケータを用いて、 100ミクロンの序さに強布した。これら4種の基底を30℃にて12時間放死し、放ぶ根上の検状の硬化性材料を完全に硬化させた。

次に、上記硬化を終了した4種の基板のそれぞれについて、改基板の両型から 3000 mJ/cm の景の の景外線を開射してポジ型ドライフィルムの個体 歴を可能化させた。可能化処理を終えた4種の基板のそれぞれを、オリフィスを形成する位置にて 切断し、ポジ型ドライフィルムから成る個体層の 始級を貫出させた。

鼓幅面を露出させた4種の花板を、それぞれ5% NaOR 水溶液中に投液し、超音液洗浄槽中にて約10分間溶解除虫の操作を行なった。溶解除虫投作後の苔板を、それぞれ純水で5分間洗浄し、依後させた。

こ ようにして作成された4個の娘 戦制記録 ヘッドの被視器中には、いずれの場合にも関係形 の残骸が全く存在しなかった。更に、これら液体 戦計記録ヘッドを記録整貫に救着し、純水/グリ セリン/ダイレクトプラック154(水溶性異色染 村) = \$3/30/5 から成るインクジェットインクを 加いて記録を行なったところ、安定な印字が可能 であった。

実施例2

実施例 1 と同様の第 8 題の構成の液体検射記録 ヘッドを作成した。

まず、液体吐出エネルギー発生素子としての圧 電体Pbficaを接着したガラス基板上に、アルカリ 水溶液に可溶な樹脂であるスチレン/マレイン酸 共全合体(共量合比50/50、全量平均分子量 56000)のHEK 溶液を塗布し、依備後25ミクロン序 さの層を形成させた。この層の上に質アルカリネ 溶 域 で 現 像 可 値 な 感 光 性 ドラ イフィルム 「RISTON」(商品名、デュ・ポン・ド・ネモアー ス・Co)をラミネートした後、上記圧像体上にレ

被視點構成部材としてNiおよびCrを用い、第6 図の構成の液体検射記載へっドを作成した。

まず、液体吐出エネルギー発生素子として電气 熱変操体(材質RIB」を形成したガラス造板上 に、ボジ型ドライフィルム「DZATEG R225」(ヘ キストジャベン(接))から成る原さ25mmの感光 層を形成した後、第6回に対応するガラスマスク を重ね、液旋路形成子定部分を除く部分に40 eJ/cmの常外銀照射を行なった。次に1%のカ セーソーダ水溶液にセスプレー現像を行ない、上 記憶無数で換件を含むガラス搭板上の物能路形成 予定部分に厚さ約25mmの関体層を形成した。ここ で、オリフィス保は、長さ2mm、巾20mm、関係 30mmであった。

四 層が形成された高板をマグネトロン方式スパックリング装置に入れ、四体層が形成されている 芸板の 表面に、全国 Grの0.1 μ 層を形成した。次に、この芸板をpH 4.5の塩化ニッケルと破離ニッケルを主体とす。電解メッキ槽に装限し、50℃で\$0分メッキを行ない、約80ミクロンのニッ

ジスト観を残すようにマスクを重ね、80mJ/cm/の 信外後照射を行なった。

便射部分を成 させた後、2%の次成ナトリウム 水溶液を用いて、フォトレジストの現像およびス チレングマレイン酸共成合体層のエッチングを行 ない、合計50ミクロンの設定で120 ミクロンピッ ナのレリーフの異体層を形成した。

この基板上に、実施例1のエポキシ樹脂を用いて、 250ミクロンの厚さの硬化性樹脂醇を形成した。

以下、実施例1と同様の方法で因休野の除去を 行なったところ、除去は空全に行なわれており、 また良好な形状の液体略計記録へってが形成 されていた。この液体吸射記録へっドを記録装置 に取り付けて3ヶ月間記録試験を行なったが、イ ンク中への折出物の発生や目前りによる吐出不安 定は起こらず、安定な印字が可能であった。ま た、オリフィスの変影や別様等も全く発生してい なかった。

突线侧3

ケル暦を形成した。

政策協構成部材としてのNiiとGrの政語が終了した基板に、 破機論ロを開け、オリフィス先編を基板の切断によって質出させた。 次に、 この基板を、エタノール/ドデシルベンゼンスルホン数=85:5 (各重量係)から成る器合被中に接流し、組合被作物でで的10分間溶解缺去の操作を行なった。 溶解除去操作後の指板を、純水で5分間沈浄し位機させた。

このようにして作成された液体質計記量へッドを記録整盤に取り付けて、3ヶ月間記録試験を行なったが、インク中への析出物の発生や目訪りによる吐出不安定は起こらず、安定な印字が可能であった。また、オリフィスの変形や対離等も全く 免化していなかった。

第 1 液
2 - D < 1

- 5) 主要構成個位の位置合わせを容易にして確実 に為すことができ、寸法精度の高いヘッドが必要 り良く得られる。
- 8) 高密度マルチアレイ液体噴射窓具ヘッドが簡 島な方法で得られる。
- 7) 放使路を構成する構型の厚さの選整が提めて 容易であり、固体層の厚さに応じて原型の寸法 (例えば、講復さ)の複複路を構成することがで — さる。
 - 8) 遺誌、且つ大量生産が可能である。
 - 5) エッチング被(ファ化水素酸等の強酸類)を 特に使用する必要がないので、安全衛生の面でも 使れている。
 - 10) 接着剂を特に使用する必要がないので、接着 例が変勢して得が塞がれたり、液体吐出エネル ギー発生者子に付着して、概能低下を引き起こす ことがない。

(. 図面の簡単な反射

第1回乃至前6 図は、水発明の帯水的な悪傷を 説明するための核式図で り、それぞれ、部1図

【発明の効果】

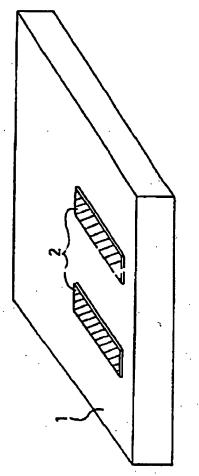
以上に設明した水発明によってもたらされる始 果としては、下記に列 するようなものが挙げら れる。

- 1) ヘッド製作のための主要工程が、いわゆる印刷技術、すなわちフォトレジストや終光性ドライフィルト等を用いた製品加工技術に図る為、ヘッドの創密部を、所望のパターンで、しかも極めてな品に形成することができるばかりか、河橋成の多数のヘッドを同時に加工することもできる。
- 2) 中性でない水溶液、あるいは有機溶解を媒体とする記録機に対して相互に影響し合うことがなく、且つ核密性あるいは機械的機関等にも優れた。 付料も、ヘッド構成材料として用いるので、記録 数数としての耐久性あるいは質額性を高めること。 ができる。
- 8) 製造工程数が少なく、生産性が良好である。
- () ヘッド免機の切断、研磨等の加工、処理を特に必要としないので、非智りの向上、コストダウンをはかることができる。

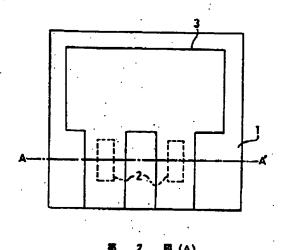
- 1 --- 盆板
- 2 --- 舷体吐出エネルギー発生妻子
- 3 --- 四作局
- (--- 被沈路确定 好
- 5 --- 液体设路
- 8 --- 被供給口
- ? --- 旋點壁

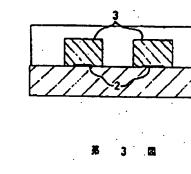
1 --- 天根 11 --- オリフィス

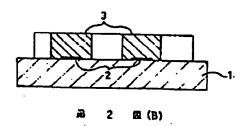
> りか出頭人 ヤノン住式会社 代 足 人 若 林 選挙

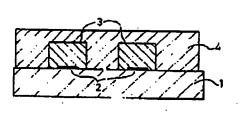


7



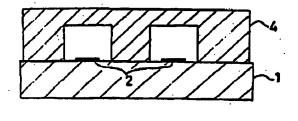






五 4 名

特開昭61-154947(9)



第 5 図

